도핑농도에 따른 다결정 3C-SiC 마이크로 공진기의 특성

정귀상†・이태원

Characteristics of poly 3C-SiC micro resonators with doping concentrations

Gwiy-sang Chung[†] and Tae-won Lee

Abstract

This paper describes the characteristics of poly 3C-SiC micro resonators with $3 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19}$ cm⁻³ doping concentrations. The 1.2 µm thick cantilever and the 0.4 µm thick doubly clamped beam resonators with different lengths were fabricated using poly 3C-SiC thin films. The characteristics of poly 3C-SiC micro resonators were evaluated by quartz and a laser vibrometer in vacuum at room temperature. The resonant frequencies of micro resonators decreased with doping concentrations owing to reduction in the Young's modulus of poly 3C-SiC thin films. It was confirmed that the resonant frequencies of poly 3C-SiC resonators could be applied to MEMS devices and bio/chemical sensor applications.

Key Words : poly 3C-SiC, resonator, cantilever, doubly clamped beam

1. 서 론

최근 M/NEMS 기술을 이용하여 높은 품질계수을 가지면서 초소형화 및 MMIC(monolithic microwave integrated circuit)화가 가능한 마이크로 공진기에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다^[1,2]. 이러한 공진기 제작 에 있어서 원하는 주파수 특성을 갖는 공진기를 설계 하는 것이 아주 중요하다.

일반적으로 마이크로 공진기의 공진주파수는 식(1) 과 같이 표현된다. 식(1)에서 h는 두께 [m], L은 길이 [m], E는 영률 [Pa], ρ는 질량밀도 [kg/m³] 그리고, λ_n 은 진동모드에 따른 상수를 각각 나타낸다.

$$f_n = \frac{(\lambda_n)^2}{2\pi\sqrt{12}L^2} \frac{h}{L^2} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$
(1)

원하는 주파수 특성을 갖는 공진기를 설계 및 제작하 기 위해서는 식(1)에서와 같이 마이크로 공진기의 기하 학적인 형상과 박막의 물성을 제어함으로서 가능하다.

[†]Corresponding author: gschung@ulsan.ac.kr

넓은 범위에서 주파수 제어를 목적으로 공진기 설계 시 에는 기하학적 구조를 변화시키는 것이 유리하지만, 좁 은 범위에서의 주파수 제어를 목적으로 할 경우에는 박 막의 물성을 변화시키는 것이 큰 장점을 지닌다.

3C-SiC(cubic silicon carbide)는 비교적 낮은 질량밀 도와 높은 영률을 가지므로 높은 주파수를 갖는 공진 기 제작에 아주 적합한 광대역 반도체이다^[3]. 또한, 다 결정 3C-SiC는 산화막, 질화막 등을 희생층으로 하는 표면 미세가공기술 적용이 쉽기 때문에 M/NEMS(micro/ nano electro mechanical systems)형 공진기 제작이 용 이하다^[4]. 게다가, 다결정 3C-SiC는 in-situ 도핑을 통 하여 도핑농도를 변화시킴으로서 박막의 기계적 특성, 즉 영률의 제어가 가능하다^[5].

본 연구에서는 0~40 sccm의 N₂ 도핑가스 유량을 제 어하여 3×10¹⁷~1×10¹⁹ cm⁻³인 도핑농도를 갖는 다결 정 3C-SiC 박막을 성장하였으며 이를 이용하여 외괄보 형 및 양단이 고정된 빔형 공진기를 제작하여 특성을 분석하였다. 공진기의 특성을 분석하기 위해 수정 진동 자와 레이져 변위계를 이용하여 진공상태에서 측정 및 분석하였다.

2.실 험

본 연구에서는 HMDS(hexamethyildisilane: Si₂(CH₃)₆))

울산대학교 전기전자정보시스템공학부(School of Electrical Eng., University of Ulsan)

⁽Received : February 6, 2009, Revised : March 18, 2009 Accepted : March 26, 2009)

전구체와 N₂ 도핑가스로 산화막위에 in-situ 도핑된 다 결정 3C-SiC 박막을 성장시켰다^[4]. 또한, CHF₃, Ar, O₂ 가스를 이용하여 마그네트론 RIE 공정으로 3C-SiC 박막 패턴을 형성하였다^[6]. 마지막으로 BOE(buffered oxide etch)를 사용하여 산화막을 제거하고 TMAH (tetramet hylammonium hydroxide)를 이용하여 약 20 분간 Si기판를 식각한 결과, 길이, 폭 두께가 각각 40 ~100, 10, 1.2 µm인 외팔보형 공진기와 길이, 폭, 두께 가 각각 60~100, 10, 0.4 µm인 양단이 고정된 빔형 공 진기를 제작하였다.

제작된 공진기의 특성을 분석하기 위하여 11 MHz 의 공진주파수를 가지는 수정 진동자를 액츄에이터로 사용 하였다. 그리고 레이져 변위계를 이용하여 주파수에 따 른 변위를 진공상태(2.7×10⁻⁵Torr)에서 측정하였다¹⁷.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 제작된 다결정 3C-SiC 마이크로 공진기의 FE-SEM 이미지로 윗 및 아래부분은 외괄보형과 양단 이 고정된 빔형 공진기이다.

Fig. 2(a)와 (b)에서는 외팔보형 및 양단이 고정된 범형 공진기의 도핑농도에 따른 공진주파수 변화를 나타내는데, 두 공진기 모두 도핑농도가 증가할수록 공진주파수가 감소함을 알 수 있다. 이는 3C-SiC 박 막이 N형으로 도핑되는 과정에서 질소원자가 탄소원 자를 치환하게 되는데, 이때, N(0.7 Å) 원자의 공유결 합반지름이 C(0.77 Å)와 Si(1.17 Å)의 공유결합 반지 름 보다 작아서 SiC 박막 내부에 대체결합에 의한 격 자 수축이 발생한다. 이처럼, 도핑물질의 주입은 박막



Fig. 1. FE-SEM image of fabricated poly 3C-SiC micro resonators.



Fig. 2. Variation of resonant frequencies of poly 3C-SiC micro resonators with doping gas flow.

에서 격자상수의 변형으로 인한 스트레스를 유발하고, 이것은 박막의 기계적 성질인 영률과 경도를 감소시 키게 된다^[8,9]. 이와 같이 다결정 3C-SiC 박막의 영률 이 감소함으로서 공진주파수가 도핑농도에 따라서 감 소한 것으로 사료된다. 그러므로 보다 높은 공진주파 수를 갖는 공진기를 실현하기 위해서는 보다 낮은 도 핑농도를 갖는 다결정 3C-SiC 박막 성장 기술이 요구 된다.

도핑가스 유량에 따른 질량밀도의 변화가 미세하다 고 가정할 때, 기하학적 구조가 같은 두 공진기의 공진 주파수의 비는 식(2)와 같이 사용된 박막의 영률의 비 에 제곱근과 같다.

$$\frac{f_1}{f_2} = \sqrt{\frac{E_1}{E_2}}$$
(2)

응력에 의한 영향이 적은 외팔보형 공진기의 실험결



Fig. 3. Young's modulus variations of poly 3C-SiC thin films with doping gas flow.

과를 바탕으로 식(2)을 이용하여 도핑농도에 따른 다결 정 3C-SiC 박막의 영률을 계산하였고, 그 결과를 Fig. 3 에 나타내었다. 도핑농도가 3×10¹⁷~1×10¹⁹ cm⁻³로 증가 함에 따라 영률은 305~157 GPa로 감소함 알 수 있다.

4. 결 론

본 연구에서는 in-situ 도핑된 다결정 3C-SiC 박막을 기반으로 외괄보형 및 양단이 고정된 범형 공진기를 제작하여 도핑량이 공진기의 특성에 미치는 영향을 분 석 및 평가하였다. 마이크로 공진기의 특성을 분석하기 위하여 수정 수정진동자와 레이져 변위계를 사용하였 다. 측정결과, 두 종류의 공진기 모두에서 도핑농도가 증가함에 따라 공진주파수가 감소함을 확인하였고, 이 를 바탕으로 계산한 결과 도핑농도가 3×10¹⁷~ 1×10¹⁹ cm⁻³로 증가함에 따라 영률은 305~157 GPa로 감소함 알 수 있다. 또한, 높은 주파수 특성을 갖는 공 진기를 실현하기 위해서는 도핑농도가 낮은 다결정 3C-SiC 박막 성장 기술이 요구된다.

따라서, 다결정 3C-SiC 박막의 도핑농도를 이용하여 공진기의 특성을 제어할 수 있기 때문에 원하는 주파 수 특성을 갖는 마이크로 혹은 나노 공진기는 무선통 신 부품 및 바이오/화학 센서로 유용하게 응용될 것으 로 기대된다.

정 귀 상

• 센서학회지 제17권, 제6호, p. 425 참조

• 현재 울산대학교 전기전자정보시스템공학부 교수

5. 감사의 글

본 연구는 지식경제부·울산광역시 지원 울산대학교 네트워크 기반 자동화연구센터의 지원에 의한 것입니다.

참고 문헌

- P. S. Waggoner, and H. G. Craighead, "Micro- and nanomechanical sensors for environmental, chemical, and bio logical detection," *Lap Chip*, vol. 7, pp. 1238-1255, 2007.
- [2] C. T. C. Nguyen, L. P. B. Katehi, and G. M. Rebeiz, "Micromachined devices for wireless communications," *Proc. IEEE*, vol. 86, pp. 1756-1768, 1998.
- [3] Y. T. Yang, K. L. Ekinci, X. M. G. Huang, L. M. Schiavone, M. L. Roukes, and M. Mehregany, "Monocrystalline silicon carbide nanoelectromechanical systems," *Appl. Phys. Lett.* vol. 78, pp. 165-167, 2001.
- [4] K. S. Kim and G. S. Chung, "Electrical characteristics of in-situ doped poly crystalline 3C-SiC thin films deposited by using CVD," *J. Kor. Phys. Soc.*, vol. 53, pp. 822-825, 2008.
- [5] 김강산, 정귀상, "도핑농도에 따른 다결정 3C-SiC 박막의 기계적 특성," 센서학회지, 제17권, 제4호, pp. 256-260, 2008.
- [6] G. S. Chung, C. M. Ohn, "Magnetron reactive ion etching of polycrystalline 3C-SiC thin films," J. Kor. Phys. Soc., vol. 51, pp. 1673-1678, 2007.
- [7] 정귀상, 이태원, "다결정 SiC 마이크로 공진기의 제 작과 그 특성," 센서학회지, 제17권, 제6호, pp. 425-428, 2008.
- [8] B. J. Wijesundara, D. Gao, C. Carraro, R. T. Howe, and R. Maboudian, "Nitrogen doping of polycrystalline 3C-SiC films grown using 1,3-disilabutane in a conventional LPCVD reactor," *J. Crystal Growth*, vol. 259, pp. 18-25, 2003.
- [9] J. Zhang, R. T. Howe, and R. Maboudian, "Electrical characterization of n-type polycrystalline 3C-SiC thin films deposited by 1,3-dislabutane," *J. Electrochemical Soc.*, vol. 153, pp. 548-551, 2006.

이 태 원

- 센서학회지 제17권, 제6호, p. 425 참조
- 현재 울산대학교 전기전자정보시스템공학부 석사과정

- 209 -

J. Kor. Sensors Soc., Vol. 18, No. 3, 2009